

عنوان مقاله:

مقایسه خواص تشعشعی نانوپوششها در ساختارهای چندلایه ای در طیف مرئی به روش غیرهمدوس

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی تاسیسات نوین ساختمانی (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

سیدامیرعباس علومی - استادیار دانشگاه آزاد یزد

محمد امیدپناه - مربی دانشگاه فنی حرفه ای یزد

خلاصه مقاله:

اطلاع از خواص تشعشعی لایه های بسیار نازک متناوب نیمه هادیها، کاربردهای زیادی در صنایع میکروالکترونیک، تبدیل انرژی و نانوفناوری دارند. در این مقاله زیر لایه سیلیکون با دی اکسید سیلیکون و نیتريد سیلیکون پوشش داده شده است. ضخامت زیر لایه سیلیکون 500 و دما 25°C می باشد. در این کار محدوده طول موج مرئی مورد بررسی قرار گرفته است و از فرمولاسیون غیر چسبنده و سیلیکون تقویت شده استفاده شده است. ضخامت پوشش دی اکسید سیلیکون و نیتريد سیلیکون 400 می باشد. نتایج نشان داد که ضریب صدور میانگین پوشش نیتريد سیلیکون از ضریب صدور میانگین دی اکسید سیلیکون کوچکتر می باشد. و نیز ضریب بازتاب میانگین برای پوشش نیتريد سیلیکون از ضریب بازتاب میانگین پوشش دی اکسید سیلیکون بیشتر است. که این امر برای هر دو نوع یون دهنده و گیرنده مشابه است. ولی یون دهنده دارای ضریب صدور بزرگتر و ضریب بازتاب کوچکتر از یون گیرنده می باشد.

کلمات کلیدی:

نیمه هادی، دی اکسید سیلیکون، نیتريد سیلیکون، یون دهنده، یون گیرنده

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/204889>

